72Ge sous forme de tétrafluorure de germanium gazeux GeF4

Description

Le gaz de tétrafluorure de germanium enrichi est utilisé comme implant préamorphique pour empêcher les canaux dopants de la plaquette de silicium. En outre, il est utilisé pour déformer la plaquette de silicium, ce qui optimise les performances et la vitesse du dispositif.

Isotopic Abundance:

Item		70Ge	72Ge	73Ge	74Ge	76Ge
Abundance (%)	GC-MS (±0.5)	8.78	65.02	12.81	13.37	0.02

RGA Analysis

Component Analysis	Specification	Detect Limit	Units	Analysis Method
GeF4 Purity	≥99.99	/	% by Volume	GC-MS
72Ge	≥55%	0.0001	AT%	GC-MS
O2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
N2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
CO2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
SO2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
HF	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
Ar	≤25	0.1	ppmv	GC-MS

1 Mirtskhulava str.
Phone: +(995 577) 141 141
contact@siig-isotopes.com

SIIG © 2026